①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)
②名称	(Patent) Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research / Egyptian Patent Office (Marks) Internal Trade Development Authority Ministry of Trade and Industry (ITDA) Trademarks and Industrial Designs Office
③所在地	(Patent) 101 Kasr El Ainy Street, P.O. BOX 11516 Cairo (Marks) 4 Nasr Road cross Makram Ebeid Nasr City - Cairo
④連絡先	(Patent) (電話) (202) 279 21 274 / 291 /792 1272 (FAX) (202) 279 21 273 (E-mail) patinfo@egypo.gov.eg (internet)www.egypo.gov.eg (Marks) (電話) (202) 267 20 452 (FAX) (202) 267 20 453 (E-mail) egypt.id@gmail.com (internet)WWW.ITDA.GOV.EG
⑤組織の長	Egyptian Patent Office Acting President, Egyptian Patent Office : Dr. Mona Mohamed Yahia Egyptian Trademark Office Head : Dina Hamed
⑥沿革	(1) エジプトにおいては、1939 年の行政命令により商標の保護が開始された。また、1949 年に特許、意匠、工業的雛型法が制定され、1951 年の行政命令 230 号により規則が施行されて特許、意匠、工業的雛型の保護が開始された。 (2) エジプト特許庁は、1951 年法律第 132 号により 1951 年に設立され、1971 年から科学研究技術院(Academy of Scientific Research & Technology) に所属している。 (3) 2002 年法律第 82 号の新法が 2002 年 6 月 3 日に施行され、これにより TRIPS 協定に対応した。また医薬品が 2005 年末から保護されることになった。 (4) 2002 年法律第 82 号の新法の 2002 年 6 月 3 日の施行により、実用新案、半導体集積回路の回路配置もこの新法（知的財産法）により保護されることになった。
⑦所管	特許、実用新案、意匠、商標、著作権、半導体集積回路の回路配置の保護、秘密情報の保護、商号、原産地名称表示

⑩加盟条約

WIPO	ベルヌ	ブリュッセル	フィルム登録	ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ(原産地表示)
1975/4/21	1977/6/7			1952/7/1
ﾅｲﾛﾋﾞ(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ)	パリ	PLT	レコード保護	ローマ
1982/10/1	1951/7/1		1978/4/23	
シンガポール	TLT	ワシントン	WCT(著作権)	WPPT(演奏及びﾚｺｰﾄﾞ)
	1999/10/7			
ブタペスト	ヘーグ			リスボン
	ロンドンアクト	ヘーグアクト	ジュネーブアクト	
	1952/7/1		2004/8/27	
ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ(標章)	マドプロ	PCT	ロカルノ	ニース
1952/7/1	2009/9/3	2003/9/6		2005/6/18
ストラスブール	ウィーン	WTO		
1975/10/17		1995/6/30		

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)

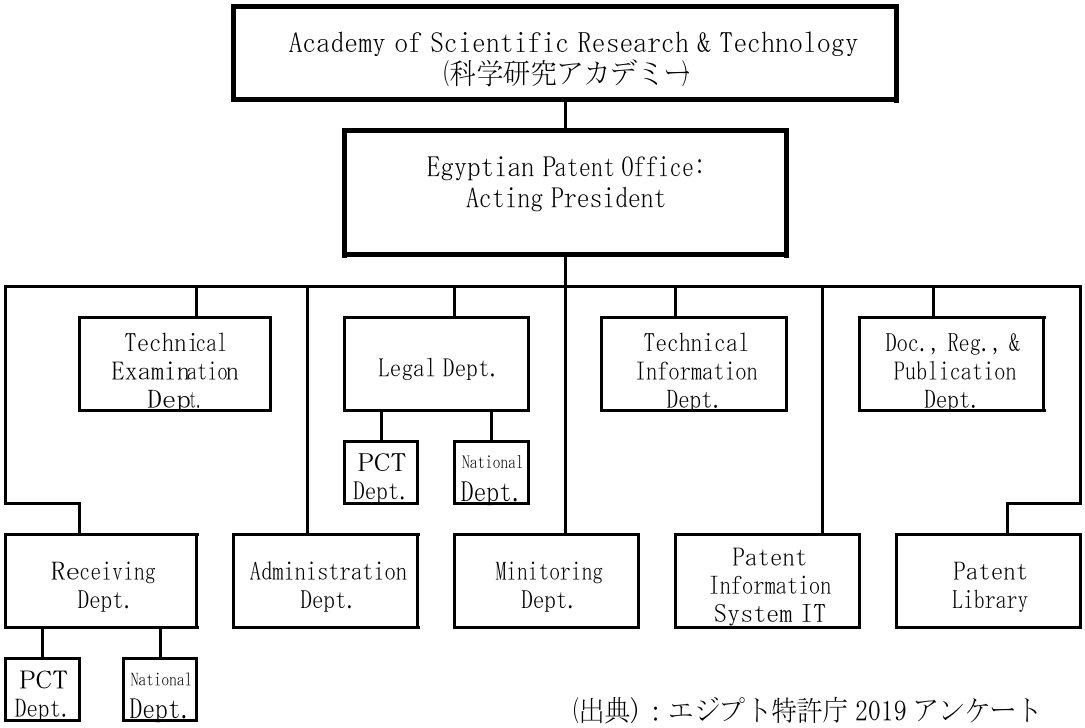
⑪統計データ

出願件数		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
特許	全数	2,207	2,224	1,914	2,066
	(内　外国出願)	1,229	1,343	1,325	1,371
	(内日本から)	97	55	76	66
	(内　PCT ルート)	1,199	1,313	1,298	1,350
実用新案	全数		8		35
	(内　外国出願)		1		10
意匠	全数	2,049	2,537	2,244	277
	(内　外国出願)	312	285	373	274
	(内日本から)	26	14	10	3
商標	全数	29,885	37,525	34,651	39,497
	(内　外国出願)	7,800	9,063	8,937	8,482
	(内日本から)	160	168	184	127
登録件数		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
特許	全数	495	508	495	295
	(内　外国出願)	430	445	407	242
	(内日本から)	23	51	42	21
	(内　PCT ルート)	404	428	392	235
実用新案	全数		8		22
	(内　外国出願)		3		4
意匠	全数	700	632	854	251
	(内　外国出願)	243	212	262	251
	(内日本から)	7	25	14	3
商標	全数	13,095	15,639	17,008	21,436
	(内　外国出願)	7,714	7,918	7,936	8,802
	(内日本から)	225	223	246	193

出典：WIPO IP Statistics

⑫　組織

特許局は Academy of Scientific research and Technology (ASRT:科学研究及び技術アカデミー)の、商標及び意匠の登録所は Administration for Commercial Registration, Ministry of Supply and Internal Trade(生活用品及び国内取引省・商業登録所)の下部組織である。



(出典)：エジプト特許庁 2019 アンケート

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
特許制度	②最新特許法の施行年月日	2002 年 6 月 3 日施行（2002 年法律第 82 号）
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	発明者及び承継人（自然人、法人）
	⑥現地代理人の必要性及び代理人の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。 (知財規則第 52 条)
	⑦出願言語	アラビア語 ただし、要約書についてはアラビア語及び英語を出願の際に添付しなければならない
	⑧特許権の存続期間及び起算日	出願日又は優先権主張があるときは優先主張日から 20 年。 (知財法第 9 条)
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物 (知財法第 3 条)
	⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ	有。次の事項が規定されている。 国内又は国際の博覧会における開示の日から 6 月 （知財法第 3 条）
	⑪非特許対象	(1)公序良俗に反する発明、又は環境、人類、動植物の生命若しくは健康を損ねる可能性がある発明 (2)発見、科学理論、数学的方法、プログラム及び計画 (3)人間及び動物に対する診断法、治療法及び外科的治療方法 (4)その希少性は又は特性は問わない動植物、並びに微生物以外の動植物の生産のための非生物学的方法及び微生物学的方法 (5)臓器、組織、生体細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム (知財法第 2 条)
	⑫実体審査の有無及び審査事項	有。 (知財法第 16 条)
	⑬審査請求制度の有無	無。 (知財法第 16 条)
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願要件を満たしているときは出願の受理が公告（公開）される。 （知財法第 16 条）
	⑯異議申立制度の有無	有。出願の公告日から 60 日以内に利害関係人は異議を申立てることができる。(付与前)　　(知財法第 16 条)
	⑰無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。
	⑱実施義務	有。登録日から 3 年、又は特許出願日から 4 年の何れか遅い方までに実施しないときは、強制実施権設定の対象となる。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
特許制度	⑲費用単位 EGL(エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料　150 EGL(学生以外)0 EGL(学生) 審査手数料 2,000 EGL(学生は無料、個人は 10EGL、教育研究機関は 300EGL、職員が 10 人未満の企業は 500EGL) 登録料 [特許権の維持に掛かる費用] 年金　(職員 10 人以上)　(職員 10 人未満)　(学生) 2 年次　20EGL　10 EGL　2 EGL 3 年次　40EGL　20 EGL　4 EGL 4 年次　80EGL　40 EGL　8 EGL 5 年次　100EGL　50 EGL　10EGL 6 年次　150EGL　75 EGL　15EGL 7 年次　200EGL　100 EGL　20EGL 8 年次　250EGL　125 EGL　25EGL 9 年次　300EGL　150 EGL　30EGL 10 年次　350EGL　175 EGL　35EGL 11 年次　400EGL　200 EGL　40EGL 12 年次　500EGL　250 EGL　50EGL 13 年次　600EGL　300 EGL　60EGL 14 年次　700EGL　350 EGL　70EGL 15 年次　800EGL　400 EGL　80EGL 16 年次　900EGL　450 EGL　90EGL 17 年次-20 年次1,000EGL(毎年)　500 EGL(毎年) 100EGL(毎年)
	⑳料金減免措置の有無	有。 学生、個人、職員数が 10 人未満の企業は出願手数料、審査手数料及び年金が減免される。
	㉑PCT における国内料金減額措置の有無	無。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
実用新案制度	②最新実新案法の施行年月日	2002 年 6 月 3 日施行（2002 年法律第 82 号）
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	考案者及び承継人（自然人、法人）
	⑥現地代理人の必要性及び代理の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。　　（知財法規則第 52 条）
	⑦出願言語	アラビア語
	⑧実用新案権の存続期間及び起算日	出願日から 7 年 （知財法第 30 条）
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物 （知財法第 3 条）
	⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ	有。次の事項が規定されている。（知財法第 3 条） ・国内又は国際の博覧会における開示の日から 6 月
	⑪不登録対象	(1)公序良俗に反する発明、又は環境、人類、動植物の生命若しくは健康を損ねる可能性がある考案 (2)発見、科学理論、数学的方法、プログラム及び計画 (3)人間及び動物に対する診断法、治療法及び外科的治療方法 (4)その希少性は又は特性は問わない動植物、並びに微生物以外の動植物の生産のための非生物学的方法及び微生物学的方法 (5)臓器、組織、生体細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム　（知財法第 2 条）
	⑫実体審査の有無及び審査事項	無。
	⑬審査請求制度の有無	無。
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願要件満たしているときは出願の受理が公告（公開）される。　　（知財法第 16 条）
	⑯異議申立制度の有無	有。出願の公告日から 60 日以内に利害関係人は異議を申立てることができる。（付与前）　　（知財法第 16 条）
	⑰無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。
	⑱実施義務	有。登録日から 3 年、又は特許出願日から 4 年の何れか遅い方までに実施しない ときは、強制実施権設定の対象となる。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
実用新案制度	⑲費用 単位(エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料　100 EGL(学生以外)　0 EGL(学生) [実用新案権の維持に掛かる費用] 年金　(職員 10 人以上)　(職員 10 人未満)　(学生) 2 年次　20 EGL　10 EGL　2 EGL 3 年次　40 EGL　20 EGL　4 EGL 4 年次　80 EGL　40 EGL　8 EGL 5 年次　100 EGL　50 EGL　10 EGL 6 年次　150 EGL　75 EGL　15 EGL 7 年次　200 EGL　100 EGL　20 EGL
	⑳料金減免措置の有無	有。　個人及び職員数が 10 人未満の企業は年金が減免される。
	㉑PCT における国内料金減額措置の有無	無。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
意匠制度	②最新意匠法の施行年月日	2002 年 6 月 3 日施行（2002 年法律第 82 号）
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤出願人資格	創作者及び承継人（自然人、法人）
	⑥現地代理人の必要性及び代理人の資格	要。エジプトに非居住の出願人は、エジプトに居住する代理人を選任しなければならない。
	⑦出願言語	アラビア語
	⑧意匠権の存続期間及び起算日	出願日から 10 年。更新により 5 年延長することができる。最長 15 年。 （知財法第 126 条）
	⑨新規性の判断基準	内外国公知、内外国刊行物
	⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ	有。次の事項が規定されている。期間は開示日から 6 月。 ・公認の国内又は国際博覧会における展示による意匠の開示。 （知財法第 120 条(1)）
	⑪不登録対象	(1)基本的に当該の物の技術的又は機能的な要請により生じる形状を有する意匠 (2)エジプト又はその他の国の紋章、宗教的象徴、印章を含む意匠、又はその引用にが公序良俗に反する意匠 (3)登録商標又は周知の標章と同一、類似又は酷似する意匠 （知財法第 124 条）
	⑫実体審査の有無	無。
	⑬審査請求制度の有無	無。
	⑭優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	⑮部分意匠制度の有無	有。部分意匠も意匠の要件を満たすものは登録される。
	⑯関連意匠制度の有無	無。
	⑰「組物」の意匠制度の有無	無。
	⑱意匠分類	国際分類（ロカルノ分類）を採用している。（ロカルノ協定には未加盟）
	⑲出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、方式要件を満たしているときは公報により公告(公開)される。
	⑳秘密意匠制度の有無	無。
	㉑異議申立制度の有無	有。利害関係人は、出願の公告日から 30 日以内に異議を申立てることができる。 （知財法第 122 条，知財法規則第 89 条、第 130 条）
	㉒無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。 （知財法第 133 条）

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
意匠制度	㉓登録表示義務	無。
	㉔費用単位 EGL(エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料　87 EGL(1 意匠につき)　56 EGL(1 超の各意匠につき) 登録料　120 EGL [意匠権の維持に掛かる費用] 存続期間更新料 120 EGL
	㉕料金減免措置の有無	無。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
商標制度	②最新商標法の施行年月日	2002 年 6 月 3 日施行（2002 年法律第 82 号）
	③地理的効力の範囲	エジプト国内のみ
	④他国制度との関係	無。
	⑤商標法の保護対象	商品、役務、団体商標、証明商標 （知財法第 63 条、第 69 条、第 70 条）
	⑥商標の種類	文字商標、図形商標、記号商標、結合商標、色彩商標（知財法第 63 条）
	⑦出願人資格	自然人、法人（知財法第 66 条）
	⑧権利付与の原則	先願主義 （知財法第 65 条）
	⑨本国登録要件	
	⑩現地代理人の必要性及び代理人の資格	知財法、知財法規則には必要との規定は見当たらない。
	⑪出願言語	アラビア語（知財法規則 72）
	⑫商標権の存続期間及び起算日	出願日から 10 年。10 年ごとに更新できる。 （知財法第 90 条）
	⑬ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ	有。次の事項が規定されている。 ・国内又は国際の博覧会における開示の日から 6 月 （知財法第 72 条、知財法規則 83、85）
	⑭不登録対象	(1)顕著性に欠ける標章、又は製品についての単なる説明、写真、表示に過ぎないもののみ使用が認められるか、標準的な図面若しくはその画像である記号又は表示を構成する標章 (2)公序良俗に反する標章 (3)公的な紋章、旗章及びその他州、地域的若しくは国際的組織に関するその他の記章及びその模倣 (4)宗教上の特徴を表わす表象に同一又は類似する標章 (5)同意を得ていない個人の肖像又はその者の紋章 (6)出願人がそれに対する権利を自ら証明できない名誉学位の称号 (7)公衆を誤認又は混同させる可能性があるか又は物若しくはサービスであろうとも、商品の原産地又はその他の品質に関する虚偽の記述を含む標章及び地理的表示並びに虚偽の、模倣又は偽造された称号を含む標章 （知財法第 67 条）
	⑮防護標章制度の有無	無。
	⑯周知商標制度の有無	有。周知商標には、次のいずれかの要件が求められている。 (1) 一般の消費者によく知られていること (2) (1)の要件を満たさないときには裁判所によって証明されていること （知財法第 68 条）
	⑰一出願多区分制度の有無	無。
	⑱実体審査の有無及び審査事項	有。出願は、登録要件、登録適格性、既登録商標との類似性が審査される。 （知財法第 77 条）
	⑲審査請求制度の有無	無。

①国名	Arab Republic of Egypt (EG) (エジプト・アラブ共和国)	
商標制度	⑳優先審査制度・早期審査制度の有無	無。
	㉑出願公開制度の有無	無。出願公開制度はないが、出願が受理されると公報により公告（公開）される。
	㉒異議申立制度の有無	有。利害関係人は、公告日より 60 日以内に異議申立を行うことができる。 (付与前)　(知財法第 80 条)
	㉓無効審判制度の有無	無。無効審判制度はないが、利害関係人は、無効を裁判所に提訴することができる。　(知財法第 82 条)
	㉔不使用取消制度の有無	有。5 年。継続して 5 年間の不使用は、不使用取消の対象となる。 （知財法第 91 条）
	㉕商標分類	国際分類(ニース分類、第 10 版)を採用している。
	㉖図形要素の分類	国際図形分類(ウィーン分類)を採用している。（ウィーン協定には未加盟）
	㉗譲渡要件	無。商標は、営業とは関係なく譲渡することができる。 （知財法第 87 条）
	㉘費用単位 EGL (エジプト・ポンド)	[出願から登録までに掛かる費用] 出願料　50 EGL(1 分類、1 標章) 25 EGL(1 超の各分類につき) 登録料　100 EGL(1 分類、1 標章) [商標権の維持に掛かる費用] 存続期間更新料　100 EGL
	㉙料金減免措置の有無	無。